

## ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

プラズマエッチング装置は、気密な処理室内に配設された載置台を含む。載置台はウエハを載置する主載置面と、フォーカスリングを載置する副載置面とを有する。載置台内には主載置面及び副載置面に冷熱を付与するための冷却機構が配設される。副載置面とフォーカスリングとの間に導電性シリコンゴムからなる熱伝達媒体が介在する。押圧機構によってフォーカスリングが副載置面に向けて押圧される。熱伝達媒体は、熱伝達媒体がない場合よりも、副載置面とフォーカスリングとの間の熱伝導性を高める。

Plasma Etching Apparatus